

光設計研究グループ 第28回研究会 「光リソグラフィーを支える光設計」

【日時】 2003年5月30日（金） 10:00～17:40

【場所】 東京工芸大学 芸術学部 芸術情報館 1階メインホール
東京都中野区本町2-4-7

営団地下鉄丸の内線・都営地下鉄大江戸線「中野坂上」駅下車、徒歩8分
(1番出口より山手通りを渋谷方面に進み、本町2丁目交差点を右折)

プログラム

10:00	開会の挨拶	
10:10	1. ODF2002 Best Paper Award受賞講演 ステッパー投影レンズに適した収差関数	○松山 知行 氏 (ニコン)
10:50	2. 超高性能ステッパー投影レンズの最先端	○石山 敏朗 氏、松山 知行 氏 (ニコン)
11:30	3. 収差にロバストな露光法	○東木 達彦 氏 (東芝)
12:10	昼食	
13:20	4. EUVリソグラフィー用ミラーの反射率測定	○渡辺 豊 氏 (キヤノン)
14:00	5. 最近のリソグラフィ用光源技術開発の状況 ○溝口 計 氏、都丸 仁 氏 (ギガフォトン)、住谷 明 氏 (コマツ)、遠藤 彰 氏 (EUVA)	
14:40	6. CZ法による大口径フッ化カルシウム単結晶の育成	○柳 裕之 氏 (トクヤマ)
15:20	休憩	
15:40	7. 投影光学系の収差低減	○吉原 俊幸 氏 (キヤノン)
16:20	8. ステッパー投影レンズの収差とフレアー ○渋谷 真人 氏、福井 俊文 氏 (東京工芸大学)	
17:00	9. RET (超解像技術)	○福田 宏 氏 (日立製作所)
17:40	閉会の挨拶	
17:50	懇親会	

【主催】日本光学会(応用物理学会)光設計研究グループ(代表:丸山 晃一[ペンタックス(株)])

【参加費】光設計研究グループ会員 4000円、光設計研究グループ学生会員 無料、
一般 10000円、学生一般 2000円。当日、受付けにてお支払い下さい。

【定員】150名(定員になり次第締め切ります。定員オーバー後の申込みはその旨ご連絡致します。)

【参加申込】下記申込書の内容をE-mailまたはFAXまたは郵送にて下記申込先にお送り下さい。

【申込先】富士写真フイルム(株) 宮台技術開発センター 宮M 西畑 純弘

〒258-8538 神奈川県足柄上郡開成町宮台 798

TEL: 0465-85-4964(直通)、FAX: 0465-85-2141、E-mail: k28reg@opticsdesign.gr.jp

【問合せ先】キヤノン(株) 高精密光学技術センター 光学11設計室 石井 弘之

〒321-3298 栃木県宇都宮市清原工業団地 23-10

TEL: 028-667-5711(代表)、FAX: 028-667-9325、E-mail: k28@opticsdesign.gr.jp

【ホームページ】<http://www.opticsdesign.gr.jp/>

富士写真フイルム(株) 宮台技術開発センター 宮M 西畑純弘 行

光設計研究グループ 第28回研究会 申込書

氏名(フリガナ)	
所属	
住所 TEL、FAX E-mail	
参加区分(○印)	1. 光設計研究グループ会員、2. 学生会員、3. 一般、4. 学生一般
懇親会(○印)	1. 参加、 2. 不参加 (懇親会は参加無料です)